

ダイオキシン類関係各種基準

1 ダイオキシン類に係る環境基準

媒体	基準値
大気	年平均値 0.6 pg-TEQ/m ³ 以下
水質	年平均値 1 pg-TEQ/L以下
土壌	1,000 pg-TEQ/g以下
底質	150 pg-TEQ/g以下

2 大気基準適用施設及び大気排出基準(施行令第1条別表第1) (単位:ng-TEQ/m³N)

号番号	特定施設の種類の	施設規模	新設施設 排出基準	既存施設 排出基準	On
1	銑鉄製造の用に供する焼結炉 (1 t/h以上)		0.1	1	15%
2	製鋼の用に供する電気炉 (変圧器定格容量1000KVA以上)		0.5	5	
3	亜鉛回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鋇炉、溶解炉 及び乾燥炉 (0.5 t/h以上)		1	10	
4	アルミニウム合金製造の用に供する焙焼炉・乾燥炉(0.5 t/h以上)、溶解炉(容量1t以上)		1	5	
5	廃棄物焼却炉 (火床面積0.5m ² 以上又は 焼却能力50kg/h以上)	4t/h以上	0.1	1	12%
		2t/h以上4t/h未満	1	5	
		2t/h未満	5	10	

3 水質基準対象施設及び水質排出基準(施行令第1条別表第2) (単位:pg-TEQ/L)

号番号	特定施設種類	排出基準
1	硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	
3	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
4	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
5	担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設	
6	塩化ビニルモノマー製造の用に供する施設のうち二塩化エチレン洗浄施設	
7	カプロラクタムの製造の用に供する施設のうち、硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設	
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設、廃ガス洗浄施設	
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設	
10	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造の用に供する施設のうち、ろ過施設、廃ガス洗浄施設	
11	ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設	
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
13	亜鉛の回収の用に供する施設のうち、精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
14	担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。))によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設	
15	火床面積0.5m ² 以上又は燃焼能力50kg/h以上の廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及びその廃棄物焼却炉から生じる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの	
16	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設	
17	フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
18	上記の施設(1~17,19)から排出される下水を処理する下水道終末処理施設	
19	上記の施設(1~17)を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設	